

# **AIXTRON SE**

## **Ordentliche Hauptversammlung 2016**

Hotel Pullman Aachen Quellenhof, Aachen

25. Mai 2016

### **Redebeitrag zu Tagesordnungspunkt 1 „Fokussierung im Blick“**

**Martin Goetzeler**

Vorstandsvorsitzender (CEO)

**Dr. Bernd Schulte**

Vorstandsmitglied (COO)

Es gilt das gesprochene Wort.

© AIXTRON SE

Investor Relations

Mai 2016

## **[Folie Redebeiträge zu TOP 1]**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

herzlich willkommen zur Hauptversammlung der AIXTRON SE 2016 – auch im Namen von Dr. Bernd Schulte und mir.

Wir haben am Montag eine wegweisende Entscheidung für AIXTRON und seine Aktionäre angekündigt.

Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen die Absicht des Fujian Grand Chip Investment Funds über seine deutsche Tochtergesellschaft Grand Chip Investment GmbH die Mehrheit der Anteile der AIXTRON SE zu erwerben. Wir sehen hierin eine große Chance für das Unternehmen und seine Aktionäre.

Sie haben vermutlich die Berichterstattung mit den Details zu der im Raum stehenden Transaktion verfolgen können. Lassen Sie mich nur ganz kurz die Vorteile, die wir sehen, ansprechen, bevor wir dazu übergehen das letzte Geschäftsjahr zu betrachten:

- Das Angebot ist attraktiv und stärkt AIXTRON.
- Fujian Grand Chip steht hinter AIXTRONs Strategie, Forschung und Entwicklung voranzutreiben, die Entwicklung von neuen Produkten zu fördern, zur Marktreife zu bringen und das Portfolio zu erweitern – ganz zum Nutzen unserer Kunden und Mitarbeiter.
- Die Transaktion gibt uns eine langfristige Perspektive, unsere Ziele auf allen unseren Technologiefeldern zu erreichen.
- Die F&E-Kompetenz und die bestehenden Technologien der AIXTRON-Gruppe werden in den vorhandenen Technologiezentren verbleiben.
- Die AIXTRON-Gruppe wird ihr IP-Portfolio, das bei AIXTRON in Deutschland verbleibt, weiter stärken und schützen – und wird Technologien weiterentwickeln.
- Der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE verbleibt in Herzogenrath, Deutschland.
- Die Transaktion ist auf Wachstum und nicht auf Kosten- oder Personalreduzierungen ausgerichtet.
- Wir erhalten einen deutlich besseren Zugang zu Wachstumsmärkten und können die Wettbewerbsfähigkeit von AIXTRON in China verbessern. Das nützt allen Standorten.
- Und, meine Damen und Herren, Ihnen den Aktionärinnen und Aktionären von AIXTRON, werden EUR 6,00 pro Aktie in bar angeboten – eine unmittelbare Wertsteigerung der Anteile – mit einem Aufschlag von 50,7% auf den durchschnittlichen Dreimonatsbörsenkurs vor der Ankündigung

Wir werden auf die Transaktion später im Rahmen der Generaldebatte weiter eingehen. Zunächst zum Bericht über das Geschäftsjahr 2015.

Ein herausforderndes, turbulentes Jahr 2015 liegt hinter uns. Wir haben mit der unerwarteten Reduzierung des San'an-Auftrags zwar einen schmerzlichen Rückschlag verkraften müssen, gleichzeitig aber auch eine Menge Positives zu vermelden. Wir haben es trotz eines nach wie vor strikten Kostenmanagements geschafft, die Diversifizierung von AIXTRON weiter voranzutreiben und den Konzern auf mehrere Säulen zu stellen. Die Zahlen des Geschäftsjahres 2015 – und hier insbesondere die Erreichung des geplanten positiven EBITDA im zweiten Halbjahr – belegen, dass wir zwar nicht alle, aber viele unserer finanziellen Ziele erreicht haben – und dies ohne Rückenwind des Marktes.

Lassen Sie mich zunächst exemplarisch auf vier zentrale Punkte des letzten Jahres eingehen: Was hatten wir uns für 2015 vorgenommen und was haben wir erreicht?

#### 1. Fortschritte in der Diversifizierung

Wir wollten das Unternehmen auf eine breitere Basis stellen, es unabhängiger vom Geschäft mit Produktionsanlagen für blaue und weiße Galliumnitrid-LED machen.

Dabei sind wir 2015 deutlich vorangekommen: Fast 75% unserer Systemumsätze haben wir mit Anlagen zur Herstellung optoelektronischer Halbleiter für Anwendungen wie Laser, Infrarot oder Solarzellen, für Leistungshalbleiter und Siliziumanwendungen erzielt. Nur ein Viertel der Umsätze entfiel noch auf LED-Anwendungen. Eine Voraussetzung für diesen Erfolg war die konsequente Fortsetzung der Strategie hier auf zwei Plattformen zu setzen - die Planeten- und die Showerhead-Technologie.

Denn die Nachfrage nach Anwendungen wie Infrarot oder Lasern für die Datenkommunikation, nach Leistungshalbleitern für Elektro- und Hybridautos sowie Erneuerbaren Energien steigt stetig. In diesen Feldern, die vor allem auf unsere Planetenreakorttechnologie setzen, verfügen wir aktuell - wenn auch bei einem nicht sehr großen Marktvolumen - über einen Weltmarktanteil von annähernd 70%. Diese Position gilt es nun abzusichern und in Zukunft auszubauen, um so auch die in den vergangenen drei Quartalen zurückeroberte Marktführerschaft beim Auftragseingang für MOCVD-Anlagen zu verteidigen.

#### 2. Weitere Stärkung von Forschung & Entwicklung

Wir wollten unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf hohem Niveau vorantreiben, um unsere Produkte zeitgerecht im Markt zu positionieren.

Wir haben unseren Worten auf der letztjährigen Hauptversammlung Taten folgen lassen und unsere F&E-Projekte in den verschiedenen Produktsegmenten konsequent weiter vorangetrieben. Insgesamt haben wir dafür 2015 über EUR 55 Mio. in die Hand genommen, wobei auf unsere Zukunftsfelder OLED und

III/V auf Silizium sowie Kohlenstoff-Nanoröhren und Leistungshalbleiter mehr als die Hälfte dieser Ausgaben entfallen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir diese Ausgaben sehr bewusst und im Hinblick auf die Eröffnung neuer Marktchancen für AIXTRON tätigen. Diesen strategischen Ansatz könnten wir mit dem Einstieg eines finanzstarken Investors wie Grand Chip Investment, der sich klar zur Weiterentwicklung unserer Produktfahrpläne und der Fortsetzung unserer Strategie bekannt hat, mit Nachdruck fortsetzen.

Ein besonderer Fokus lag im vergangenen Jahr auf unseren Technologien **OLED** und **III/V auf Silizium (engl.: Three-Five-on-Silicon)**, wo wir mit der Durchführung erster Testreihen auf unserer OLED-Gen8-Demonstrationsanlage im Frühjahr 2016 sowie mit der Lieferung einer zweiten III/V-Anlage an einen weltweit führenden Halbleiterhersteller Ende 2015, wichtige Erfolge verbuchen konnten. Dies ist deshalb so bedeutsam für uns, weil der weiteren Leistungssteigerung von siliziumbasierten Prozessoren ab einer Strukturgröße von 7nm natürliche Grenzen gesetzt sind, sich aber gleichzeitig die Anforderungen an die Verarbeitung großer Datenmengen stetig erhöhen und wir mit der III/V-Technologie über eine vielversprechende Alternative verfügen.

In diesem Zusammenhang haben wir auch unsere Laboraktivitäten in den USA ausgebaut, um Kunden unsere neuen Technologien zur Herstellung von III/V-Verbindungshalbleitern oder die im vergangenen Jahr mit PlasmaSi erworbene **Dünnschichtverkapselung (engl.: Thin Film Encapsulation)** von OLEDs demonstrieren zu können.

Bei der Marktpositionierung neuer Produkte war die nicht geglückte Qualifizierung der AIX R6 bei unserem Kunden San'an – der jedoch nach wie vor ein Schlüsselkunde in anderen Bereichen ist – zwar eine herbe Enttäuschung. Die Qualifizierung der Anlage bei anderen Kunden wie bei Epileds und Epistar vermeldet, geht jedoch weiter.

Fortschritte haben wir auch bei Graphen und Kohlenstoff-Nanostrukturen (CNT) gemacht. Obwohl das eigentliche Wachstum erst nach 2019 einsetzen wird, befinden wir uns hier mit rund 90 Kunden, vorwiegend aus der akademischen und industriellen Forschung, in einer vielversprechenden Marktposition. Mit unserem breiten Anlagenportfolio sind wir gut aufgestellt, um vor allem Anwendungen in den Bereichen Halbleiter, Unterhaltungselektronik und Batterien zu bedienen.

### 3. Verbessertes Kostenmanagement

Wir wollten konsequent die Materialkosten unserer Produkte senken, die Produktivität im Produktions- und Servicebereich steigern, uns dadurch unabhängiger von Währungsschwankungen machen und die Kostendisziplin bei den Betriebsaufwendungen fortsetzen.

2015 konnten wir trotz eines starken US-Dollar unsere Betriebsaufwendungen auf 76,5 Mio. senken. Das ist der niedrigste Wert seit 2006. Dabei ist es uns gelungen, die Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen durch Anpassungen und Kostendisziplin nochmals zu reduzieren sowie die F&E-Kosten auf dem von uns angestrebten Niveau zu kontrollieren. Die teilweise schmerzhaften Einschnitte haben uns geholfen, hier unsere Zielgröße von EUR 80 Mio. sogar zu unterschreiten.

Fortschritte konnten wir auch in den Design-to-Cost-Projekten sowie durch Produktivitätsmaßnahmen im Produktions- und Servicebereich erzielen, was im zweiten Halbjahr 2015 auch zu einer Steigerung in der Bruttomarge beitrug.

#### 4. Profitabel auf Basis EBITDA im zweiten Halbjahr 2015

Wir wollten uns im vergangenen Jahr sequentiell verbessern und im zweiten Halbjahr profitabel werden.

Auch das haben wir erreicht, obwohl wir die vorgesehenen Umsätze aus dem San'an-Auftrag zu einem großen Teil nicht verbuchen und wir daher die ursprüngliche Umsatzprognose nicht erreichen konnten. Die Rückkehr zu einem positiven EBITDA, also einem positiven Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, in Höhe von EUR 5,7 Mio. im zweiten Halbjahr spiegelt jedoch vor allem die Diversifizierung unseres Portfolios wider – und dies sogar für das Betriebsergebnis (EBIT), das nahe dem Break-even lag.

Damit ist es uns gelungen, sicherlich auch begünstigt durch die Dollarentwicklung, den Break-even im zweiten Halbjahr auf unter EUR 250 Mio. zu senken. Insgesamt konnten wir das Ergebnis zum dritten Mal in Folge verbessern.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir sind bei wichtigen Aufgabenstellungen vorangekommen.

Herr Dr. Schulte und ich werden Sie nun in drei Blöcken über unsere Aktivitäten und Fortschritte in 2015 und in den vergangenen Monaten informieren. Dies beinhaltet

1. einen Überblick über die im vergangenen Jahr erreichten Meilensteine in der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung unseres Technologie- und Produktportfolios,
2. die Erläuterung der Finanz- und Ertragslage von AIXTRON in 2015 sowie
3. unsere Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr 2016.

Damit gebe ich das Wort an Herrn Dr. Schulte, der Sie zunächst auf den aktuellen Stand hinsichtlich unserer Technologien und Produkte bringen wird.

## [Folie - Technologieportfolio]

Guten Morgen verehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

auch ich begrüße Sie sehr herzlich zur Hauptversammlung der AIXTRON SE 2016 hier in Aachen.

Wie Herr Goetzeler dargestellt hat, beginnt sich unsere Diversifizierungsstrategie auszuzahlen.

Wir sehen damit unsere Überzeugung bestätigt, dass AIXTRON im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung mehrere Standbeine braucht und früh in attraktiven Wachstumsmärkten präsent sein muss.

Dass sich vor diesem Hintergrund größere Teile unserer Technologiefelder noch in der Entwicklungs- oder sehr frühen Wachstumsphase ihres Lebenszyklus befinden, spiegelt sich in unserer Ergebnissituation wider.

Wir sind uns bewusst, dass wir hier erheblich in Vorleistung gehen.

Die Entwicklung von Halbleiter-Technologien wie **OLED** oder **III/V auf Silizium** erfordern einen hohen Kapitaleinsatz – und dieser wird in Zukunft noch weiter steigen.

Klar ist aber, dass wir weiterhin signifikant und gezielt in die Diversifizierung und damit auch in die Weiterentwicklung der von uns definierten Zukunftsfelder investieren müssen, um gegen die Konkurrenz am Weltmarkt bestehen zu können.

Dabei fokussieren wir uns auf Technologien rund um unsere Kernkompetenz, die Deposition von komplexen Materialien aus der Gasphase.

Hier besteht aus unserer Sicht weiterhin großes Potenzial in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Lassen Sie mich daher mit unserem größten Bereich, der Opto- und Leistungselektronik, beginnen.

## **Opto-Power**

### **[Folie Lebenszyklus]**

Als generellen Trend beobachten wir hier in jüngster Zeit eine Verschiebung der Nachfrage hin zu hochleistungsfähigen und energieeffizienten Bauteilen für den Einsatz in Kommunikation, Datenspeicherung oder Elektromobilität.

Daher zieht das Geschäft für Produktionsanlagen für die Herstellung dieser Art von Halbleitern an, während die Nachfrage nach Produktionsanlagen für Leuchtdioden (LED) zuletzt stagnierte.

### **[Folie Technologieportfolio]**

#### **LED**

Entsprechend hat sich der Markt für MOCVD-Anlagen für LED zuletzt nur noch schwach entwickelt.

Das erscheint auf den ersten Blick paradox, da der Trend zur LED-Beleuchtung – Sie werden das in Ihrem Alltag ebenfalls bemerken – ungebrochen ist.

Dies lässt sich jedoch wie folgt erklären:

- die in den letzten Jahren insbesondere in Asien geschaffenen Überkapazitäten sind noch immer nicht vollständig kompensiert worden,
- die Nachfrage nach LED-Chips ist schwächer gestiegen als angenommen,
- und die Hersteller befinden sich zusätzlich in einem sehr intensiven Wettbewerb.

Diese Faktoren führen kurzfristig zu einer verhaltenen Investitionsbereitschaft vieler Kunden und langfristig zu einem Markt, in dem zwar ältere Anlagen durch neue, effizientere Maschinen ersetzt werden, Großaufträge wie in der Vergangenheit aber wahrscheinlich Seltenheitswert haben werden.

Die Vermarktung unserer AIX R6-Showerhead-Anlage, deren Qualifizierung bei San'an Optoelectronics im vergangenen Jahr zwar unerwartet aufgrund nicht erreichter Spezifikationen scheiterte, die wir inzwischen jedoch - wie bereits erwähnt - bei unseren taiwanesischen Kunden Epileds und Epistar erfolgreich qualifizieren konnten, wird durch die angesprochene Marktsituation nicht erleichtert.

Allerdings erwarten wir in den nächsten Monaten weitere Entscheidungen unserer R6-Kunden, die uns hier weiteren Aufschluss über die künftigen Marktchancen geben werden.

Unser Ziel für die kommenden Monate ist es, die Qualifizierung der Anlagen für den Produktionsbetrieb bei unseren Kunden erfolgreich abzuschließen.



Diese schwierige Phase im LED-Markt nutzen wir gemeinsam mit unseren Kunden, um die Ausbeute von LED-Chips durch weitere Optimierung der Homogenität der Abscheidung zu steigern.

Diese Optimierung könnte in Zukunft mit unseren Planetenanlagen so weit getrieben werden, dass unsere Kunden auf nachgelagerte Prozesse wie das Sortieren der LED-Chips verzichten könnten und dadurch signifikante Kosteneinsparungen erzielen.

## **Leistungselektronik**

Energieeffizienz ist einer der wichtigsten Trends weltweit. Unser Beitrag hierfür sind Depositionstechnologien für neuartige **Leistungshalbleiter** aus Materialien wie Galliumnitrid (GaN) oder Siliziumkarbid (SiC), die beginnen, die Bauelemente aus Silizium zu ersetzen.

Zwar besitzen die letztgenannten nach wie vor den größten Marktanteil, doch der große Vorteil von Halbleitern aus Galliumnitrid und Siliziumkarbid liegt in der erheblichen Energieeinsparung durch geringere Verluste oder der Möglichkeit, diese Bauelemente aufgrund ihrer höheren Effizienz erheblich zu verkleinern.

Wichtigste Anwendungen sind beispielsweise Umrichter zur Einspeisung regenerativer Energien oder in der Elektro- und Hybridfahrzeugtechnik.

Wir beobachten in diesem Bereich nach der F&E-Phase zur Qualifizierung der neuen Leistungselektroniksysteme eine zunehmende Kommerzialisierung und Industrialisierung.

Dazu zählt in jüngster Zeit etwa die Verwendung von Leistungsbaulementen für das kabellose Laden („Wireless Charging“) von Smartphones oder die energieeffizientere Steuerung von Spülmaschinen oder Klimaanlage.

Weltweit arbeiten wir in der Leistungselektronik inzwischen mit fast 50 Unternehmen zusammen, von denen einige beim Übergang von der F&E- in die Produktionsphase bereits Folgeaufträge an AIXTRON erteilt haben.

Mit unseren Planetenanlagen der Typen AIX G5 WW (Warm-Wall) und AIX G5+ C sind wir der führende Anbieter in der Leistungselektronik mit einem – Herr Goetzeler sagte es bereits - Weltmarktanteil von annähernd 70%.

Diese Position wollen wir durch konsequente Unterstützung unserer Kunden und die Förderung der bestehenden Marktstrukturen weiter ausbauen, um so diesen vielversprechenden Wachstumsmarkt schon beim Übergang von der Entwicklungs- in die Produktionsphase zu besetzen.

### **Three-Five-On-Silicon (TFOS)**

Auch in der **Siliziumhalbleiterindustrie** kommt unsere MOCVD-Technologie erfolgreich zur Anwendung.

Auf Basis so genannter III/V-Verbindungshalbleiter, die auf Elementen der chemischen Gruppen III und V beruhen, ist eine Fortsetzung der Steigerung der Leistungsfähigkeit von Prozessoren möglich.

Stand heute gehen wir davon aus, dass diese Technologie bei 7nm lateraler Strukturgröße von Logikchips wahrscheinlich ab 2018 zum Einsatz kommen wird.

Dass diese Einschätzung richtig ist, zeigt die Lieferung einer CRIUS-R-Anlage zur Herstellung von III/V-Verbindungshalbleitern an einen der weltweit führenden Halbleiterhersteller im 4. Quartal 2015.

Unser Team, das sich aus Kollegen aller AIXTRON-Standorte zusammensetzte, hat hier hervorragende Arbeit geleistet und die nach speziellen Kundenwünschen geplante Anlage im vorgegebenen Zeitrahmen erfolgreich beim Kunden installiert.

### **Atomic Layer Deposition (ALD)**

In der Siliziumhalbleiterindustrie investieren wir nicht nur in die gerade vorgestellten MOCVD-Anlagen, sondern sind auch mit unserer Atomlagen-Depositionstechnologie für die Massenproduktion von Festkörperspeichern etabliert.

Hier befinden wir uns in einem Markt, der zwar durch Kapazitätsschwankungen und harte Preiskämpfe gezeichnet ist, in dem wir aber in 2015 im Geschäft mit unserem Hauptkunden starkes Wachstum verzeichnen konnten.

Wir sehen hier gute Chancen, denn es befinden sich derzeit noch weitere unserer QXP-Anlagen bei zwei anderen Speicherchipherstellern in der Qualifikationsphase.

Die Qualifikation dieser Anlagen gehört in diesem Jahr zu unseren wichtigsten Zielen, um in Zukunft Produktionsanlagen an diese Kunden liefern zu können.

### **OLED & Dünnschichtverkapselung (TFE)**

Im Bereich unserer Depositionstechnologie zur Herstellung von **organischen Halbleitern** haben wir im vergangenen Jahr wieder wichtige Fortschritte erzielt.

Dazu zählte nicht nur die Inbetriebnahme unserer Gen8-Demonstrationsanlage – Gen8 ist eine Glasfläche von 2,3 mal 2,4 Metern - sondern auch die im März 2016 erreichte Fähigkeit dieser Anlage zur Demonstration von OLED-Depositionsprozessen auf großer Fläche.

Meine Damen und Herren,

Sie alle werden inzwischen einiges über organische Leuchtdioden (OLED) gehört haben, nicht zuletzt durch deren Verwendung in Smartphones, zunehmend auch in Fernsehern und vereinzelt auch in Lampen.

Wir bewegen uns hier also in einem stetig wachsenden Markt – und an diesem Wachstum möchten wir partizipieren.

Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit den weltweit größten OLED Herstellern. Auch erste Testreihen wurden bereits umgesetzt.

Im Lauf der zweiten Jahreshälfte erwarten wir hier Signale aus der Industrie, die uns Klarheit hinsichtlich der weiteren Kommerzialisierung unserer Technologie verschaffen werden. Denn die Vertiefung der Zusammenarbeit mit einem OLED Hersteller ist entscheidend für die weiteren Schritte zur Entwicklung der OVPD-Technologie.

Diesen wichtigen Meilenstein haben wir mit unserer OLED-Dünnschichtverkapselungstechnologie OPTACAP™, die wir im April 2015 von PlasmaSi erworben haben, schon erreicht.

Die Technologie ist ein Schlüssel für die Herstellung hochleistungsfähiger, flexibler OLEDs und ermöglicht beispielsweise den Bau von faltbaren Displays. AIXTRON ist hier mit dem ersten Auftrag für eine Forschungsanlage in Q3/2015 und laufenden Gesprächen mit anderen Display-Herstellern auf einem guten Weg.

### **Kohlenstoff-Nanotechnologie (CNT)**

Eine Technologie, die sich derzeit noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet ist die zur Herstellung von hochreinen kohlenstoffbasierten Materialien wie **Graphen, Kohlenstoff-Nanoröhren und -Nanodrähten**.

Sie hat das Potenzial künftig in Anwendungen wie Displays, Batterien, Halbleitern und vielen mehr zum Einsatz zu kommen.

Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, unsere weltweit führende Position in der akademischen und industriellen Forschung weiter zu stärken und neue Produkte wie die BM Spider auf den Markt zu bringen, eine Anlage zur Abscheidung von Graphen auf Metallfolien.

Die stabile Nachfrage nach unseren PECVD-Anlagen zeigt, dass unsere Anlagentechnologie für die Kunden ein wichtiger Schlüssel für den Einsatz dieser zukunftsweisenden Materialien ist.

Daher ist es unser Ziel, die gute Marktpositionierung von AIXTRON in diesem Bereich weiter zu stärken und auszubauen.

Damit kommen wir zum zweiten großen Themenblock, der **Finanz- und Ertragslage** des Geschäftsjahres 2015 und der des ersten Quartals 2016.

Dazu gebe ich das Wort wieder zurück an Herrn Goetzler und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

## [Folie – Quartalsweise Entwicklung]

Sehr geehrte Damen und Herren,

in 2015 konnten wir im zweiten Halbjahr wie geplant ein positives EBITDA erzielen, den Umsatz erneut leicht verbessern, unser selbstgestecktes Ziel von EUR 80 Mio. für die Betriebsaufwendungen erreichen und die Verluste weiter verringern.

Im Vergleich zum Vorjahr ging der Gesamtauftragseingang zwar leicht zurück. Die Liquidität von EUR 209,4 Mio. sowie eine Eigenkapitalquote von 82% zum 31. Dezember 2015 verdeutlichen jedoch unsere hohe finanzielle Solidität.

Der weltweite Trend zur LED-Beleuchtung ist zwar ungebrochen, aufgrund der bestehenden Überkapazitäten sowie des intensiven Wettbewerbs war aber die Investitionsbereitschaft der LED-Produzenten auch in 2015 sehr verhalten. Zudem mussten wir im zweiten Halbjahr eine abgeschwächte Nachfrage nach Anlagen im Speichergeschäft verkraften.

Bestätigt wird dies durch einen rückläufigen **Gesamtauftragseingang**, der 2015 mit EUR 167,1 Mio. 16 Prozent unter dem Vorjahreswert von EUR 198,7 Mio. blieb.

Die **Umsatzerlöse** für das Geschäftsjahr 2015 stiegen gegenüber dem Vorjahr um 2% von EUR 193,4 Mio. auf EUR 197,8 Mio. Damit konnten wir zum zweiten Mal in Folge eine Umsatzsteigerung verzeichnen, obwohl der chinesische Großkunde die neue AIX R6 entgegen unseren Erwartungen nicht qualifizierte und wir in der Folge das ursprüngliche Umsatzziel 2015 nicht erreichen konnten. Allerdings ist es uns gelungen, diese fehlenden Umsätze durch signifikante Steigerungen in anderen Technologiebereichen zum Teil auszugleichen.

76% oder EUR 151,0 Mio. der gesamten Umsatzerlöse entfielen auf Anlagenumsätze, obwohl der Anteil der MOCVD-Anlagen zur Produktion von LEDs nur noch 26% des Anlagenumsatzes ausmachte. Der Hauptanteil von 60% der gesamten Umsatzerlöse entfiel auch in 2015 auf die Nachfrage von Kunden aus Asien. Allerdings lag er damit um 23 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, was nicht zuletzt auf die deutliche gesunkene Nachfrage nach LED-Produktionsanlagen zurückzuführen ist. Gleichzeitig stiegen die Umsatzanteile Europas auf 18%, während sich die Umsatzerlöse auf dem US-amerikanischen Markt auf 22% mehr als vervierfachten.

## [Folie GuV Konzern]

Im Geschäftsjahr 2015 erzielten wir ein weiter verbessertes positives **Bruttoergebnis** in Höhe von EUR 49,8 Mio. und eine auf 25% gestiegene Bruttomarge. Ausschlaggebend hierfür waren sowohl eine verbesserte Produkt- und Preisstruktur als auch positive Währungseinflüsse.

Dies ist nicht zuletzt auf unsere in den letzten Jahren umgesetzten Effizienz- und Produktivitätsverbesserungen zurückzuführen, wie etwa das Design-to-Cost-Projekt zur langfristigen Senkung der Produktkosten unter Einbeziehung von Entwicklung und Einkauf, neue Konzepte für unser Service-Geschäft oder die jüngste Neustrukturierung des Materialeinkaufs.

Infolge einer besseren Kostenkontrolle sowie sonstigen betrieblichen Erträgen aus positiven Währungseffekten und höheren Forschungszuschüssen, lagen die **Betriebsaufwendungen** im Geschäftsjahr 2015 mit EUR 76,5 Mio. im Rahmen unseres selbstgesteckten Kostenzieles von EUR 80 Mio.

Die **Vertriebs- und Verwaltungskosten** lagen im Geschäftsjahr 2015 mit EUR 27,8 Mio. rund 20% unter dem Vorjahr. Dies ist in erster Linie auf geringere Abschreibungen, auf die geringere Anzahl von Mitarbeitern und auf die verringerte Nutzung externer Dienstleistungen zurückzuführen.

Auch die Aufwendungen im Bereich Forschung & Entwicklung sanken im vergangenen Geschäftsjahr um 17 Prozent von EUR 66,7 Mio. auf EUR 55,4 Mio. Ausschlaggebend hierfür waren hauptsächlich die Einsparungen durch das bereits im Vorjahr initiierte Restrukturierungsprogramm. Denn die F&E-Aktivitäten für die OLED- und Siliziumhalbleiterindustrie haben wir im Hinblick auf ihre weitere Kommerzialisierung im gleichen Zeitraum weiter intensiviert.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen** summierten sich im Jahr 2015 auf einen betrieblichen Ertrag in Höhe von EUR 6,7 Mio. im Vergleich zu einem Ertrag von EUR 2,2 Mio. im Vorjahr. Die in dieser Position ebenfalls ausgewiesenen öffentlichen Zuschüsse für Forschung und Entwicklung, die AIXTRON für seine Teilnahme an geförderten Forschungsprojekten erhält, waren mit EUR 3,0 Mio. fast doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Umsatz- und Kostenentwicklung hat sich die Ertragslage zwar weiter verbessert, lag damit aber immer noch im negativen Bereich. So verbesserte sich das **Betriebsergebnis** im Geschäftsjahr 2015 von EUR -58,3 Mio. auf EUR -26,7 Mio. und das **Ergebnis vor Steuern** von EUR -57,1 auf EUR -26,0 Mio.

Aufgrund landesspezifischer **Ertragsteuern** wies AIXTRON im vergangenen Geschäftsjahr einen Ertragsteueraufwand in Höhe von EUR 3,2 Mio. aus. In einigen Landesgesellschaften fallen landesspezifische Steuern auf lokal erzielte Gewinne an, die in der Summe ausgewiesen werden. Im Geschäftsjahr 2015 wurden auf

Verlustvorträge in Höhe von EUR 161,2 Mio. keine latenten Steuerforderungen aktiviert.

Das Nettoergebnis des AIXTRON Konzerns für das Geschäftsjahr 2015 betrug damit EUR -29,2 Mio. im Vergleich zu EUR -62,5 Mio. in 2014. Das war zwar deutlich besser, aber natürlich nicht zufriedenstellend. Dieser reduzierte Verlust reflektiert sowohl die Fortsetzung des intensiven Restrukturierungsprozesses, den AIXTRON in den vergangenen beiden Jahren durchlaufen hat, die hohen Zukunftsaufwendungen als auch die weiterhin vorsichtige Investitionsnachfrage in wichtigen Kundenmärkten.

## **[Folie Kennzahlen SE]**

Die Muttergesellschaft des AIXTRON Konzerns, die AIXTRON SE, weist im Geschäftsjahr 2015 nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) einen Bilanzverlustvortrag in Höhe von EUR -87,3 Mio. aus. Im Unterschied zum Nettoverlust des Konzerns wurden in der SE Beteiligungsgewinne aus den Landesgesellschaften vereinnahmt, die zu einer positiven Abweichung führten.

Meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre,

aufgrund dieser Ertragslage werden wir auch in diesem Jahr den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2015 auf neue Rechnung vortragen und für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende ausschütten.

Kommen wir zurück zum AIXTRON Konzern und seiner Bilanz.



## **[Folie - Bilanz Konzern]**

Trotz der Verluste im Geschäftsjahr 2015 ist AIXTRON auch weiterhin schuldenfrei und verfügte zum Jahresende 2015 über einen Bestand an liquiden Mitteln inklusive kurzfristiger Finanzanlagen in Höhe von EUR 209,4 Mio. Das sind 22% weniger als im Vorjahr. Die wichtigsten Gründe hierfür waren die Akquisition der PlasmaSi sowie die teilweise Rückzahlung bereits erhaltener Anzahlungen von San'an Optoelectronics, die aufgrund der vereinbarten Verringerung des Auftragsvolumens fällig wurden.

Der zum 31. Dezember 2015 auf EUR 70,8 Mio. gesunkene Vorratsbestand spiegelt sowohl den niedrigen Auftragsbestand zum Jahresende als auch die Abschreibungen auf Vorratsbestände wider.

Die anderen Vermögenspositionen waren gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Im Vergleich zu dem Wert von 78% am 31. Dezember 2014 stieg die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2015 leicht auf 82%. Dies ist insbesondere auf den strukturellen Effekt geringerer Kundenanzahlungen und der damit einhergehenden, geringeren Bilanzsumme zurückzuführen. Der Anstieg der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten von EUR 3,2 Mio. auf EUR 25,0 Mio. war auf die vorgesehene Rückzahlung des zweiten Teils der San'an-Anzahlung zurückzuführen. Die Zahlung dieser Tranche erfolgte im ersten Quartal 2016.

Insgesamt verfügt AIXTRON damit weiterhin über eine starke Kapitalbasis und ist finanzierungsseitig nach wie vor solide aufgestellt.

## **[Folie - Kapitalflussrechnung]**

Nachdem die Gesellschaft im Vorjahr Mittelabflüsse in Höhe von EUR 33,8 Mio. verzeichnete, verbuchte AIXTRON im Geschäftsjahr 2015 einen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 45,7 Mio. Darin wirkte hauptsächlich die Teilrückzahlung bereits erhaltener Anzahlungen an San'an.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 41,2 Mio. ist in erster Linie auf die Auflösung von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten in Höhe von EUR 60,5 Mio. zurückzuführen, die zuvor als sonstige finanzielle Vermögenswerte bilanziert wurden. Diesem Effekt wirkten die zuvor erwähnten Investitionen in Höhe von EUR 13,3 Mio. sowie die Zahlungen aus der Akquisition der PlasmaSi, Inc. in Q2/2015 entgegen.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von EUR 0,145 Mio. resultiert aus dem Erwerb eigener Aktien im Berichtszeitraum, die nur teilweise durch Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien ausgeglichen werden konnte.

Im Geschäftsjahr 2015 hat AIXTRON von der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien Gebrauch gemacht und am 28. Mai 2015 insgesamt 35.053 Aktien der Gesellschaft zu einem Durchschnittskurs von EUR 7,14 zurückgekauft. Dieser Durchschnittskurs lag rund 1 Prozent unter den durchschnittlichen Schlusskursen der AIXTRON Aktie in den vorangegangenen drei Handelstagen vor dem Rückkauf. Die eigenen Aktien dienen der langfristig orientierten, aktienbasierten variablen Vergütung, welche mir nach einer Wartezeit von 3 Jahren überschrieben werden, wie dies im Vergütungsbericht des Geschäftsjahres 2015 ausgewiesen ist.

Der Free Cashflow betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr EUR -57,3 Mio., was insbesondere auf die Teilrückzahlung der von San'an bereits geleisteten Anzahlungen zurückzuführen ist.

Ich versichere Ihnen, dass wir ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Liquidität legen, wobei insbesondere die Entwicklung des Free Cashflows als Steuerungsgröße eine wesentliche Rolle spielt.

## **[Folie – Kennzahlen Q1/2016]**

Lassen Sie mich nun zum Abschluss der Finanzanalyse noch kurz auf die aktuelle Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr eingehen. Den Zwischenbericht für das erste Quartal 2016 haben wir am 26. April vorgelegt.

Positiv entwickelt sich vor allem das Geschäft mit Halbleitern für die Opto- und Leistungselektronik, da die Nachfrage nach hochleistungsfähigen und energieeffizienten Bauteilen für den Einsatz beispielsweise in Kommunikation, Datenspeicherung oder Elektromobilität stetig steigt. Zudem haben wir im ersten Quartal eine gestiegene Nachfrage insbesondere nach Produktionsanlagen für rot-orange-gelbe (ROY) LED verzeichnet. Die Nachfrage für Anlagen im Siliziumbereich verlief weiterhin schleppend, wir rechnen jedoch mit einer Erholung im Lauf der nächsten Quartale.

Das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres entwickelte sich auf Basis des Auftragsbestandes vom 31. Dezember 2015 sehr verhalten, obwohl sich das Auftragsniveau insbesondere im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen erheblich verbesserte.

Der Gesamtauftragseingang stieg gegenüber Q4/2015 um 42% auf EUR 44,4 Mio. und blieb damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von EUR 48,9 Mio. In Bezug auf die MOCVD-Anlagen konnten wir den Wettbewerber zum dritten Mal in Folge hinter uns lassen.

Der Anlagen-Auftragsbestand am Ende des ersten Quartals lag mit EUR 67,7 Mio. zwar 14% unter dem Vorjahresstand in Höhe von EUR 79,0 Mio., verbesserte sich aber gegenüber dem Anfangsbestand des Jahres 2016 in Höhe von EUR 42,9 Mio. um 58%.

Mit EUR 21,4 Mio. spiegeln die Umsatzerlöse des ersten Quartals die niedrigen Auftragseingänge in der zweiten Jahreshälfte 2015 wider. Hauptgrund ist hier die nach wie vor zurückhaltende Investitionsbereitschaft unserer Kunden, insbesondere die zuletzt schwache Nachfrage nach Produktionsanlagen für Galliumnitrid-basierte, also blaue und weiße LED-Anwendungen.

Das Bruttoergebnis in Q1/2016 verringerte sich im Jahresvergleich von EUR 8,8 Mio. auf EUR 3,1 Mio., was einer Bruttomarge von 15% entspricht. Diese Reduzierung ist trotz eines günstigen Produkt-Mix auf den deutlich gesunkenen Umsatz zurückzuführen.

Die Betriebsaufwendungen im ersten Quartal 2016 blieben im Jahresvergleich mit EUR 17,8 Mio. weitgehend stabil gegenüber den EUR 17,6 Mio. in Q1/2015. Die laufenden Kosten von PlasmaSi und die im Vergleich negativen Währungseffekte konnten durch Produktivitätssteigerungen, bessere Kostenkontrolle und eine vertragliche Ausgleichszahlung kompensiert werden. Gegenüber dem Vorquartal (Q4/2015: EUR 21,1 Mio.) gingen die Betriebsaufwendungen um 16% zurück, was

hauptsächlich in höherer Produktivität und höheren sonstigen betrieblichen Erträgen begründet liegt.

Aufgrund der bereits beschriebenen Faktoren verringerte sich das Betriebsergebnis/EBIT in Q1/2016 gegenüber dem Vorjahr von EUR -8,8 Mio. auf EUR -14,7 Mio. Das Nettoergebnis für Q1/2016 sank entsprechend.

Bei diesem Vergleich sollten jedoch sowohl die neu hinzugekommenen Kosten von rund EUR 1,3 Mio. für die in zweiten Quartal 2015 übernommene PlasmaSi, als auch die im Vergleich negative Differenz währungsbedingter Translations- und Bewertungsunterschiede in Höhe von rund EUR 4,7 Mio. zum Quartalsende betrachtet werden, in Summe EUR 6 Mio. zusätzliche Belastungen.

Die zuvor erwähnte Rückzahlung an San'an sowie die Zahlung im Zusammenhang mit dem Erwerb der PlasmaSi schlagen sich auch in der Cashflow-Entwicklung des ersten Quartals nieder. So lag der operative Cashflow bei EUR -19,4 Mio., während sich der Free Cashflow auf EUR -20,3 Mio. belief. Ohne die genannten Effekte hätten sich beide Kennzahlen nahe dem Break-even bewegt.

## **II. Ausblick**

### **[Folie – Zusammenfassung und Ausblick]**

Meine Damen und Herren,

Sie sehen, wir haben zahlreiche wichtige Fortschritte gemacht und – wenn auch nicht alle – so doch viele unserer Ziele in 2015 erreicht. Zudem sind wir vom Potenzial unserer Technologie-Lösungen überzeugt: In fast allen Technologiefeldern, vor allem jedoch in der Opto- und Leistungselektronik, ist AIXTRON entweder Marktführer oder nimmt eine führende Position ein. Doch sind gerade unsere neuen Technologien mit hohen Zukunftsaufwendungen verbunden und diese nehmen aufgrund kürzerer Produktzyklen und immer höherer Vorleistungen aus den strategischen Partnerschaften mit unseren Kunden noch zu.

Wie bereits in unseren Prognosen angekündigt, wird auch 2016 eine Herausforderung für AIXTRON. Wir gehen zwar davon aus, dass sich die Märkte von Produktionsanlagen für Laser, Leistungshalbleiter und spezielle LED-Anwendungen weiterhin positiv entwickeln werden; die Märkte von Produktionsanlagen für LED und Speicherelemente dagegen werden weiterhin von Preisdruck und Überkapazitäten gekennzeichnet sein und daher wohl auch in 2016 keinen Rückenwind in Form einer positiven Marktentwicklung liefern.

Dennoch wollen wir 2016 Umsatzerlöse zwischen EUR 170 Mio. und EUR 200 Mio. erzielen. Vorausgesetzt wir erreichen das obere Ende dieser Bandbreite und der Dollarkurs bewegt sich weiter bei 1,10 zum Euro, erwarten wir eine erneute, wenn auch nur leichte Verbesserung der Ertragslage. Dabei werden die Zahlen weiter negativ sein. Voraussetzung zur Erreichung dieser Ziele sind die erfolgreiche Markteinführung unserer OLED-Technologie und der Abschluss wichtiger Qualifizierungsprojekte bei unseren Kunden für unsere MOCVD-Anlage AIX R6 sowie die ALD-Technologie. In allen Fällen erwarten wir noch in diesem Jahr zählbare Ergebnisse.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

lassen Sie mich zusammenfassen: Wir haben im zweiten Halbjahr 2015 gezeigt, dass eine positive Entwicklung mit unserem Produkt- und Technologieportfolio von AIXTRON möglich ist. Dennoch waren die Umsatzvolumina weiterhin nicht zufriedenstellend und kurzfristig ist noch keine Besserung in Sicht. Doch trotz aktuell schwieriger Marktbedingungen liegen vor allem in unseren Zukunftsfeldern attraktive Chancen, die wir aktiv nutzen wollen, um langfristig zu wachsen.

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich die Markteinführung neuer Technologien bei gleichzeitig weiterlaufendem Investitionsbedarf zeitlich nach hinten verschieben kann. Hierbei muss man sich die Frage nach der Finanzierbarkeit gerade größerer F&E-Projekte stellen. Die Konsequenz daraus könnten Anpassungen im Portfolio

oder Kostensenkungen sein. Optionen, die weder der Aufsichtsrat noch wir als Vorstand präferieren.

Mit der Unterstützung durch einen kapitalstarken Investor wie Fujian Grand Chip könnte die Antwort darauf erheblich leichter fallen, denn damit können wir unser gesamtes Technologieportfolio zur Marktreife bringen und uns einen besseren Zugang zu den zentralen Wachstumsmärkten für Halbleiter, insbesondere in China verschaffen. Gerade deshalb ist Ihre Entscheidung über das Angebot von Fujian Grand Chip von großer Bedeutung für die Zukunft von AIXTRON.

An dieser Stelle möchten Herr Dr. Schulte und ich uns bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre aktive Unterstützung unserer Strategie und Arbeit bedanken. Ein großer Dank gilt natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitnehmervertretern, die sich tagtäglich mit großem Einsatz für unser Unternehmen engagieren. Nur auf einem solchen Fundament war es möglich die Meilensteine des vergangenen Jahres zu erreichen.

Meine Damen und Herren,

Ihnen, den Eigentümern unseres Unternehmens, möchte ich in besonderem Maße für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung danken. Wir konnten bereits einige wichtige Schritte nach vorn machen – sind aber noch lange nicht am Ziel. Unsere Zukunftstechnologien zur Marktreife zu bringen, den Kundennutzen unserer Produkte zu erhöhen, die Produktivität kontinuierlich zu steigern. Daran werden wir weiter hart arbeiten – ohne Wenn und Aber!

Damit gebe ich das Wort zurück an Herrn Schindelhauer.